

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNICAMPANIAVAN0219614 |
| Autore | Wang, Guilei |
| Titolo | Investigation on SiGe Selective Epitaxy for Source and Drain Engineering in 22 nm CMOS Technology Node and Beyond : Doctoral Thesis accepted by Chinese Academy of Sciences, Beijing, China / Guilei Wang |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2019 |
| Titolo uniforme | Investigation on SiGe Selective Epitaxy for Source and Drain Engineering in 22 nm CMOS Technology Node and Beyond |
| Descrizione fisica | xvi, 115 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetti | 00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| ----- | |
| 2. Record Nr. | UNICAMPANIAVAN00242855 |
| Titolo | High-Energy Charged Particles : Their Chemistry and Use as Versatile Tools for Nanofabrication / Shu Seki ... [et al.] |
| Pubbl/distr/stampa | Tokyo, : Springer, 2015 |
| Descrizione fisica | X, 74 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 333.792
540
541
620.5 |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |

